

Лаборатория Неорганической Кристаллохимии Кафедра Неорганической Химии, Химический Факультет МГУ

Симметрия обратного пространства. Дифракция рентгеновских лучей на реальных объектах. Теоретическая дифрактограмма.

- 1. Структурная амплитуда как комплексная величина.
- 2. Симметрия в обратном пространстве.
- 3. Факторы, влияющие на интенсивность рефлексов.
- 4. Теоретическая дифрактограмма.

#### Комплексная амплитуда рассеянного излучения:

$$\hat{A}_{hkl} = \hat{A}_0 F_{hkl} = \hat{A}_0 \sum_j g_j t_j (\mathbf{q}_{hkl}) e^{2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)} F_{atom}^j (\mathbf{q}_{hkl})$$
  
Очевидно, что:

$$F_{hkl} = |F_{hkl}|e^{i\varphi_{hkl}} = \sum_{j} A\cos 2\pi (hx_{j} + ky_{j} + lc_{j}) + iB\sin 2\pi (hx_{j} + ky_{j} + lc_{j})$$

Стоит отметить, что в эксперименте мы регистрируем интенсивности:

$$I_{hkl} \propto \left| A_{hkl} \right|^2 \propto \left| F_{hkl} \right|^2$$

#### Из этого следует, что мы получаем информацию о |*F*<sub>hkl</sub>|, но не об их фазах

# Кстати: в отсутствие аномального рассеяния *F*<sub>atom</sub> – действительная величина

Пусть существует некоторая операция симметрии А

$$\mathbf{x}'_{atom} = \mathbf{A}\mathbf{x}_{atom}$$

Тогда для рассеивающего фактора:

$$\hat{A}(\mathbf{q}) = \hat{A}_0 \sum_{i} e^{i\mathbf{q}\mathbf{x}_j} F_{atom}^{j}(\mathbf{q})$$

Можно записать аналогичное соотношение в обратном пространстве

$$\mathbf{q'} = \mathbf{A}^T \mathbf{q}$$

Т.е. симметрия прямого пространства «переносится» в обратное пространство

Самый простой случай – центр инверсии. Тогда F<sub>hkl</sub> – действительная величина (в предположении действительных F<sub>atom</sub>)

$$F_{hkl} = |F_{hkl}|e^{i\varphi_{hkl}} = \sum_{j} A\cos 2\pi (hx_{j} + ky_{j} + lc_{j}) + iB\sin 2\pi (hx_{j} + ky_{j} + lc_{j})$$

Тогда для дифракционных векторов  $q=(h_rk_rl)$  и  $q'=(-h_r-k_r-l)$  в отсутствие аномального рассеяния

$$A_{hkl} = A_{\overline{h}\overline{k}\overline{l}}, B_{hkl} = -B_{\overline{h}\overline{k}\overline{l}}, |F_{hkl}| = |F_{\overline{h}\overline{k}\overline{l}}|, \varphi_{hkl} = -\varphi_{\overline{h}\overline{k}\overline{l}}$$
  
Из этого прямо следует:  $I_{hkl} = I_{\overline{h}\overline{k}\overline{l}}$ 

Дифракционная картина центросимметрична (закон Фриделя)

> - аналогичные законы имеют место и для других дифракционных методов (ED, Neutrons)



# 2.1 Симметрия в обратном пространстве

## Симметрия обратной решетки = Лауэ-класс кристалла (точечная группа + центр инверсии)

#### Т.о. каждому вектору обратной решетки соответствует ряд эквивалентных – «звезда» векторов

Например, для кубического кристалла:

(1,0,0) (-1,0,0) (0,1,0) (0,-1,0) (0,0,1) (0,0,-1)

Фактор повторяемости  $p_{001} = 6$ 

(1,1,0) (-1,-1,0)(-1,1,0) (1,-1,0)(0,1,1) (0,-1,-1)(0,-1,1) (0,1,-1)(1,0,1) (-1,0,-1)(-1,0,1) (1,0,-1)

Фактор повторяемости  $p_{110} = 12$ 

Фактор повторяемости зависит не только от сингонии, но и от группы симметрии (точнее, Лауэ-класса) кристалла:

Тетрагональный кристалл, рефлекс (420) на дифрактограмме:



# 2.2 Систематические погасания - центрировки



#### Очевидно, что h',k',l' должны быть целочисленными.

<i>F</i> -центр.	<i>I</i> -центр.	Базоцентрированная	<i>R</i> -центр. в
h+k=2n		$C: h+k=2n  \forall h,k,l$	гексагональной установке
$h+l=2n  \forall h,k,l$	$h+k+l=2n  \forall h,k,l$	$B: h+l=2n  \forall h,k,l$	$-h+k+l=3n  \forall h,k,l$
$k+l=2n \rfloor$		$A: k+l = 2n  \forall h, k, l$	

Пусть открытым элементом симметрии является плоскость  $a_v$ 

$$(x, y, z) \rightarrow \left(x + \frac{1}{2}a, -y, z\right)$$

Тогда в выражении для *F<sub>hkl</sub>* можно выделить следующие пары:

$$F_{hkl} = \sum_{j} g_{j} t_{j} \left( e^{2\pi i (hx + ky + lz)} + e^{2\pi i (h(x+0.5) - ky + lz)} \right) F_{atom}^{j} =$$
$$= \sum_{j} g_{j} t_{j} e^{2\pi i (hx + ky + lz)} \left( 1 + e^{2\pi i (0.5h - 2ky)} \right) F_{atom}^{j}$$

Тогда при *k*=0 *h* должно быть четным (в противном случае *F*<sub>h0l</sub>=0). Условия погасания (точнее, появления☺): (*h*0l), *h* = 2n

Для оси 2<sub>1</sub>, направленной вдоль оси *x*: Условия погасания (опять же, появления): (h00), h = 2n

Набор погасаний 🕁 центрировки + открытые элементы симметрии

# 2.2 Систематические погасания

Обозначение элемента	Ориентация	Зона	Условия			
Центрировки						
A		hkl	k+l=2n			
В		hkl	h+l=2n			
С		hkl	h+k=2n			
F		hkl	h+k=2n $k+l=2n$ $h+l=2n$			
Ι		hkl	h+k+l=2n			
<i>R</i> (в гексагональной установке)		hkl	-h+k+l=3n			

# 2.2 Систематические погасания

Обозначение элемента	Ориентация	Зона	Условия			
Плоскости скользящего отражения						
	(010)	hOl	h=2n			
	(001)	hkO	h=2n			
a	(110)	hhl	h=2n			
	(100)	Okl	k=2n			
b	(001)	hkO	k=2n			
	(100)	Okl	l=2n			
	(010)	hOl	l=2n			
	(110)	hhl	l=2n			
С	(1-10)	h-hl	l=2n			
	(100)	Okl	k+l=4n (k,l=2n)			
	(010)	hOl	h+l=4n $(h,l=2n)$			
	(001)	hkO	h+k=4n (h,l=2n)			
d	(110)	hhl	2h+l=4n ( $l=2n$ )			
	(100)	Okl	k+l=2n			
	(010)	hOl	h+l=2n			
	(001)	hkO	h+k=2n			
n	(110)	hhl	l=2n			

# 2.2 Систематические погасания

Обозначение элемента	Ориентация	Зона	Условия			
Винтовые оси						
	[100]	h00	h=2n			
2 <sub>1</sub> ,4 <sub>2</sub>	[010]	0k0	k=2n			
2 <sub>1</sub> ,4 <sub>2</sub> ,6 <sub>3</sub>	[001]	001	l=2n			
	[100]	h00	h=4n			
	[010]	0k0	k=4n			
41,43	[001]	001	l=4n			
31,32,62,64	[001]	001	l=3n			
61,65	[001]	001	l=6n			

# 2.3 Выбор пространственной группы

#### 1. Определение сингонии кристалла из результатов индицирования

- 1.1 Может приводить к ошибкам (близкие по модулям вектора и т.п.)
- 1.2 Всегда руководствуйтесь правилами выбора ячейки: ячейка с

максимальной симметрией наименьшего объема.

#### 2. Анализ систематических погасаний рефлексов

- 2.1 Центрировки
- 2.2 Открытые элементы симметрии (если есть)
- 3. Выбор *наиболее высокосимметричной группы*, удовлятворяющей условиям 1 и 2.
- 4. Дальнейшее уточнение данных о симметрии кристалла в ходе решения/уточнения структуры

# Summary 1

- 1. Симметрия кристалла в прямом пространстве отражается на симметрии обратного пространства
- Интенсивности (не комплексные амплитуды!) рефлексов (*hkl*) и (-*h*,-*k*,-*l*) при отсутствии аномального рассеяния равны закон Фриделя.
- Симметрия обратного пространства (узлы обратной решетки + |F|<sup>2</sup>) характеризуется Лауэ-классом (точечная группа кристалла + центр инверсии).
- 4. В зависимости от Лауэ-класса и точечной группы дифракционного вектора q=*hkl* фактор повторяемости *p*<sub>hkl</sub>.
- 5. Центрировки и открытые элементы симметрии = систематические погасания.
- 6. Определение систематических погасаний этап в определении пространственной группы.

Комплексная амплитуда рассеянного излучения:

$$\hat{A}_{hkl} = \hat{A}_0 F_{hkl} = \hat{A}_0 \sum_j g_j t_j (\mathbf{q}_{hkl}) e^{2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)} F_{atom}^j (\mathbf{q}_{hkl})$$

*F*<sub>hkl</sub> – характеризует перераспределение амплитуды рассеянного излучения в процессе интерференции.
Этого уравнения было бы достаточно, если:

- 1. Пучок был бы монохроматическим с k = Const.
- 2. Точечный участок dV рассеивал бы как  $\hat{A}_{\mathbf{q}} = \hat{A}_0 \rho(\mathbf{r})$
- Полностью бы выполнялись условия кинематического приближения
- 4. Мы работали бы с прозрачным для РИ бесконечным идеальным монокристаллом.
- 5. Мы работали бы на идеальном инструменте и

регистрировали δ-функции.

Сферический конь в вакууме 🥹

## 3.2 Р-фактор.

Очевидно, что

$$I_{hkl} \propto \left|A_{hkl}\right|^2 \propto \left|F_{hkl}\right|^2$$

Точечный участок dV рассеивает как (Томсоновское рассеяние):



Кристалл-монохроматор сам поляризует излучение. В этом случае:

$$P = \frac{1 - K + K\cos^2 2\theta \cos^2 2\theta_M}{2}$$

К = 0.5 для неполяризованного РИ, К = 0 для нейтронов

## 3.3 Порошковая дифрактограмма vs. монокристалл

## Тогда

$$I_{hkl} = kI_0 P \big| F_{hkl} \big|^2$$

(параллельный монохроматический пучок, непоглощающий бесконченый монокристалл, кинематическое приближение)

## А что для порошковой дифрактограммы?



- Много разориентированных кристаллитов
- 2. Поглощение в образце
- 3. Разные геометрии

съемки

4. Неидеальный образец

+ неидеальный

инструмент

## Дифракция на порошке (много разупорядоченных монокристаллов).



- 1D проекция 3D картины
- Нельзя определить вектор q(h,k,l).
- Можно исследовать |q<sub>hkl</sub>|

 $\sin\theta/\lambda = |q/2|$   $2\sin\theta/|q| = (n)\lambda, n = 1,2...$ 

 $|q_{hkl}| = 1/d_{hkl}$  – межплоскостное расстояние

Какие дополительные факторы влияют на интенсивность рефлекса?

## *LPG* = *Lorentz*+*Polarization*+*Geometry*

### 1. Лоренц-фактор №1 (L)



Плотность рефлексов на сферах падает с ростом 20. Вероятность пересечь сферу Эвальда:

$$I \propto w = \frac{R_E d_{eff}}{4\pi R_q^2} = \frac{2k \sin 2\theta / \cos \theta}{16\pi k^2 \sin^2 \theta} \propto \frac{1}{\sin \theta}$$



## 1. Лоренц-фактор №2 (G)

Окно детектора фиксированной длины пересекает кольца переменного радиуса

$$I_{reg} \propto \frac{I_0}{\sin 2\theta}$$



При работе с прецизионными данными наличие монохроматора учитывать обязательно!

## 3.5 Абсорбция излучения в образце



Уравнения Гамильтона-Дарвина

$$\frac{\partial I_{S}}{\partial \mathbf{t}_{S}} = \mu I_{S}$$
$$\frac{\partial I_{D}}{\partial \mathbf{t}_{D}} = \mu I_{D} + \sigma I_{S}$$

Тогда: 
$$I_S(\theta_1, z) = I_S^0 e^{-\frac{\mu z}{\sin \theta}}$$

Для вторичного пучка:  $dI_D(\theta_2, z) = \sigma(2\theta)I_S^0 e^{-\frac{\mu z}{\sin \theta_1}} \times e^{-\frac{\mu z}{\sin \theta_2}} dl \to \sigma(2\theta)\frac{1}{\sin \theta}I_S^0 e^{-\frac{2\mu z}{\sin \theta}} dz$ 

Интегрируем по толщине образца (0 – d):

$$I_{D} = \sigma(2\theta)I_{S}^{0} \frac{1}{2\mu} \left(1 - e^{-\frac{2\mu d}{\sin\theta}}\right) \xrightarrow{d \to \infty} \sigma(2\theta)I_{S}^{0} \frac{1}{2\mu}$$
$$A = \frac{1}{2\mu}$$

## 3.6 Текстурирование



Для порошка обычно описывается феноменологически как:

 $T(hkl) \in [0,1]$ 

Подробнее? При обсуждении метода Ритвельда!

Введение коэффициента экстинкции – попытка феноменологически учесть динамические явления (двойная дифракция)



$$E = E_B \sin^2 \theta + E_L \cos^2 \theta$$

Обычно обе компоненты рассматривают как функции единственного параметра *х* 

Работа с коэффициентами экстинкции – норма для монокристального эксперимента, крайне редко необходима при работе с порошковыми данными

$$I_{hkl} = p_{hkl} A \times LPG \times T(hkl) \times E_{hkl} \times |F_{hkl}|^{2}$$

## *p*<sub>*hkl*</sub> - число симметрически эквивалентных рефлексов

Например, для кубического кристалла:

(1,0,0) (-1,0,0) (0,1,0) (0,-1,0) (0,0,1) (0,0,-1)

Фактор повторяемости  $p_{001} = 6$ 

(1,1,0) (-1,-1,0)(-1,1,0) (1,-1,0)(0,1,1) (0,-1,-1)(0,-1,1) (0,1,-1)(1,0,1) (-1,0,-1)(-1,0,1) (1,0,-1)

Фактор повторяемости  $p_{110} = 12$ 

## 2.1 Теоретическая дифрактограмма. Модельные представления.

#### Итак:

Структурная амплитуда:

$$F_{hkl} = \sum_{j} g_{j} t_{j} (\mathbf{q}_{hkl}) e^{2\pi i (hx_{j} + ky_{j} + lz_{j})} F_{atom}^{j} (\mathbf{q}_{hkl})$$

Интенсивность рефлекса:

$$I_{hkl} = p_{hkl} A \times LPG \times T(hkl) \times E_{hkl} \times |F_{hkl}|^{2}$$

Положение рефлекса:

$$2d_{hkl}\sin\theta = (n)\lambda \rightarrow d_{hkl} = \frac{1}{|\mathbf{q}_{hkl}|} \rightarrow \mathbf{q}_{hkl} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^*$$
$$\mathbf{a}^* = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot [\mathbf{b} \times \mathbf{c}]}; \mathbf{b}^* = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{b} \cdot [\mathbf{c} \times \mathbf{a}]}; \mathbf{c}^* = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{c} \cdot [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]}$$

Все это соответствует набору δ-функций в реальном пространстве

Но что же такое рефлекс?



 $PSF(2\theta) = \Omega(2\theta) * \Lambda(2\theta) * \Psi(2\theta) + B(2\theta)$ 

## 2.2 Профильная функция



Форма рефлекса может быть описана строго:  $PSF(2\theta) = \Omega(2\theta) * \Lambda(2\theta) * \Psi(2\theta) + B(2\theta)$ где:

- PSF Peak Shape Function
- B(20) функция фона
- Ω(20) Инструментальная функция
- $\Lambda(2\theta)$  Спектр источника (например  $K\alpha_{1+2}$ )
- $\Psi(2\theta)$  Функция образца

Обычно для исключения процедуры свертки используют аппроксимирующие аналитические функции:

- Функция Гаусса
- Функция Лоренца
- Функция Войта (псевдо-Войт)
- Функция Пирсона

1. Структурная амплитуда описывает соотношение между амплитудой падающей и дифрагировавшей волн для рефлекса hkl (положение рефлекса = Закон Брегга):

$$\hat{A}_{hkl} = \hat{A}_0 F_{hkl} = \hat{A}_0 \sum_{j} g_{j} t_{j} (\mathbf{q}_{hkl}) e^{2\pi i (hx_j + ky_j + lz_j)} F_{atom}^{j} (\mathbf{q}_{hkl})$$

- 2. Порошок 1D проекция 3D картины монокристалла.
- 3. Для расчета интенсивности рефлексов в реальных системах необходимо учитывать дополнительные глобальные факторы:
  - 3.1 Поляризационный фактор (Р) в любом случае (порошок, монокристалл)
  - 3.2 Лоренц-фактор (порошок)
  - 3.3 Геометрический фактор (порошок в зависимости от геометрии)
  - 3.4 Абсорбцию излучения в образцах (порошок, монокристалл)
  - 3.5 Текстурирование (порошок)
  - 3.6 Экстинкцию (динамические эффекты) обычно только монокристалл

#### 3. Для порошковых дифрактограмм удобно непосредственно использовать «фактор повторяемости» при расчете интенсивностей

4. Реальные рефлексы не δ-функции! У них есть форма, зависящая от инструмента, источника и образца.